PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-085982

(43)Date of publication of application: 30.03.1989

And the second section will be a second seco

(51)Int.CI.

CO7F 7/18

(21)Application number: 63-167029

(71)Applicant: DOW CORNING CORP

(22)Date of filing:

06.07.1988

(72)Inventor: SCHULZ JR WILLIAM J

(30)Priority

Priority number: 87 69750

Priority date: 06.07.1987

Priority country: US

(54) PREPARATION OF SILYL KETENE ACETAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To industrially advantageously the high-purity compd. for acrylate polymn. initiators, etc., by bringing a malonate compd., such as dialkyldialkylmalonate, excess triorganohalosiloxane and alkaline metal into contact.

CONSTITUTION: The dialkyldialkylmalonate having formula I (Ri is 1 to 4C alkyl), the bis(trialkylsilyl)dialkylmalonate having formula II (Rii is the same as Ri) and the malonate comp., such as dialkylmalonic acid, having formula III are brought into contact with the triorganohalosiloxane having formula IV (X is fluorine, chlorine, bromine, iodine) in the stoichiometrically excess amt. of the malonate compd. and the reaction product is separated and isolated, by which the objective compd. having formula V (Z is 1 to 4C alkyl, triorganosilyl) is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

10特許出題公閱

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-85982

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月30日

C 07 F 7/18

C-8018-4H

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全12頁)

会発明の名称

シリルケテンアセタールの製法

の特 顋 昭63-167029

願 昭63(1988)7月6日 日本

侵先権主張

愛1987年7月6日孁米国(US)到069750

⑫発 明 者

ウィリアム ジエーム ズ シュルツ, ジユニ アメリカ合衆国、ミシガン、ミッドランド、ブッチャナン

ドライブ 302

⑪出 願 人

ダウ コーニング コ ーポレーション

アメリカ合衆国, ステイト オブ ミシガン, ミツドラン

ド(番地なし)

②代 理 人

弁理士・青 木 外4名

明細帯の浄雲(内容に変更なし)

1. 発明の名称

シリルケテンアセタールの製法

2. 特許請求の範囲

1.(A) マロネート化合物をトリオルガノハロシ ロキサン及びアルカリ金属と接触させ、その際ト リオルガノハロシロキサンはマロネート化合物に 対して化学最論的に過剰に存在し、マロネート化

合物は(i)式 R'.C(COR'). を有するジアルキ ·

ルジアルキルマロネート、 (ii) 式RizC(COSiRizs)z を有するピス (トリアルキルシリル) ジアルキル

マロネート、及び(iii) 式 RiaC(COH)aを有するジ アルキルマロン酸からなる群から選ばれ、トリオ ルガノハロシランは一般式 RiisSiX (式中、Xは フッ素、塩素、臭素又はヨウ素である)を有する、 そして

(B) 得られるシリルケテンアセタールを分魁及

び単離する工程からなる、

一般式 R'zC=COSiR'' (式中、各R' 及びR'' òΖ

はそれぞれ独立して炭素原子1~4個のアルキル 益からなる群より選ばれ、2は炭素原子1~4個 のアルキル基とトリオルガノシリル基からなる群 より選ばれ、このトリオルガノシリル基は式 -SiRijを有する)を有するシリルケテンアセタ ールの調製方法。

2. 請求項1において、マロネート化合物がジ アルキルジアルキルマロネートであり、シリルケ テンアセタールが一般式 RigC=COSiRii。を有し、 OR '

マロネート化合物をトリオルガノハロシラン及び アルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (C) トリオルガノハロシランをアルカリ金属と 混合し、
- (D) トリオルガノハロシランとアルカリ金属の 混合物にジアルキルジアルキルマロネートを添加 し、そして

特開昭64-85982(2)

- (E) ジアルキルジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ金属の間の反応を促進してシリルケテンアセタールを生成する、 工程からなる方法。
- 3. 請求項1において、マロネート化合物がピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートであり、シリルケテンアセタールが一般式

Rⁱ₂C = COSiRⁱⁱ₃ を有し、マロネート化合物をト | | OSiRⁱⁱ₃

リオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (C) トリオルガノハロシランをアルカリ金属と混合し、
- (D) トリオルガノハロシラン及びアルカリ金属 の混合物にピス (トリアルキルシリル) ジアルキ ルマロネートを添加し、そして
- (E) ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケランアセター ルを生成する

4. 請求項1において、マロネート化合物がジアルキルマロン酸であり、シリルケテンアセタールが一般式 Rⁱ₂C=COSiRⁱⁱ₃ を有し、マロネート OSiRⁱⁱ。

化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (F) トリオルガノハロシランをジアルキルマロン酸と混合し、
- (G) 工程(F) で得られるトリオルガノハロシランとジアルキルマロン酸の反応を促進してピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを 生成し、
- (II) 工程(G) で得られる混合物にアルカリ金属 を添加し、そして
- (J) ピス(トリアルキルシリル)ジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセター ルを生成する

工程からなる方法。

工程からなる方法。

5. 請求項1において、マロネート化合物がジアルキルマロン酸であり、シリルケテンアセタールが一般式 Risc = CosiRii。を有し、マロネートOsiRii。

化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (K) トリオルガノハロシランの第1の部分をト リアルキルマロン酸と混合し、

て式 Ri_{*}C(COSiRii_{*})。を有するピス (トリアル キルシリル) ジアルキルマロネートを生成し、

- (M) 工程(L) で生成したビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを分離及び単離し、
- (N) トリオルガノハロシランの第2の部分をアルカリ金属と混合し、
- (P) トリオルガノハロシランの第2の部分をアルキル金属の混合物にピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを添加し、そして
 - (Q) ピス(トリメチルシリル)ジアルキルマロ

ネート、トリオルガノハロシラン、及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセター ルを生成する

工程からなる方法。

- 6. 請求項2において、アルカリ金属がナトリウムであり、トリオルガノハロシランがトリメチルクロロシランであり、ジアルキルジアルキルマロネートを基単にして化学量論的にナトリウムが約5%以上、トリメチルクロロシランが約50%以上過剰に存在し、出発接触温度が約25℃以上であり、接触時間が少なくとも2時間であり、塩化ナトリウムを譲過で除去し、シリルケテンアセタールを蒸留で分離及び単離する方法。
- 7. 請求項 3 において、アルカリ金属がナトリウムであり、トリオルガノハロシランがトリメチルクロロシランであり、ビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを基準にして化学量論的にナトリウムが約 5 %以上、トリメチルクロロシランが約 5 0 %以上過剰に存在し、出発接触温度が約 5 0 で以上であり、接触時間が少なくとも

特開明64-85982(3)

2 時間であり、塩化ナトリウムを濾過で除去し、 シリルケテンアセタールを蒸留で分離及び単離す る方法。

8. 請求項4において、トリオルガノハロリラ会がトリメチルクロロシランであり、アルカリを基準にしてトリメチルクロレ、シアルキルを以上でも当然では、150%以上であり、ロンシランの出来が対 150%以上では、150%以上であり、150%以上では、150%以上であり、150%以上では、150

 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明はシリルケテンアセタールの製造方法に 係る。より詳しく述べると、本発明はアルカリ金 属の存在におけるジアルキルジアルキルマロネー ト又はピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマ ロネートとトリオルガノハロシランの反応によっ て高純度シリルケテンアセタールを製造する方法 に関する。

(従来の技術と発明が解決しようとする課題) シリルケテンアセタール (SKA) の製造に関 する最初の文献は1950年代後半のPetrovらの<u>J.</u> <u>Gen. Chem. (USSR)</u>, 29 (1959), 2896~2899頁で あった。この文献及びこの分野の他の文献は下記 一般式の化学種を取扱っている。

> R₃Si (OC = C(CH₃)₂ | | O(CH₂)₂Z

このオルガノシラン中間体はさらに SKAと反応 して、他の方法では合成が困難な有機化合物を製

遺する能力のゆえに、価値がある。ごく最近の応用ではSKAをアクリレート重合開始剤として使用している。基移動重合(GTP: sroup transfer polymerization)として知られるこの概念はデュポンにより開発されたもので、米国特殊集 4.414.372号(Farnham ら、1983年11月8日

概念はデュポンにより開発されたもので、米国特 許第 4.414,372号 (Farnham ら、1983年11月8日 発行)、同第 4.417,034号 (Webster,1983年11月 22日発行)及び同第 4.508,880号 (Webster,1985 年4月2日発行)の3つの特許に関示されている。

シリルケテンアセタールの製造方法はこの業界でもつ知られている。第1の一般的なSKAの製法は、カルボン酸のエステルと適当な金属試薬の反応により金属エノラートを生成後にエノラートイオンをオルガノクロロシランと反応するものである。Ainsworth らのJ.Organometallic Chem.、46(1972)、59~71頁はカルボン酸のエステルとリチウムジイソプロピルアミドの反応後トリメチルクロロシランと反応するSKAの製造を記載している。KitaらのTetrahetron Letters、24:12(1983)、1273~1276頁は類似の方法による2官

能性SKAの製造を開示している。Brown の<u>」</u>
Org. Chem.、39:9 (1974)、1324~1325質はテトラヒドロフラン中の水素化カリウムとカルボニル化合物の反応による金属エノレートイオンの製造後、過剰のトリエチルアミン及びトリメチルクロロシランとの反応を記載している。

KuoらはChemical Communications (1971).

136~137 頁は式 R'R*C = C (OSi(CHs)s):
(式中、R,R*は水素、メチル基、tープチル
基又はフェニル基である。)のシリルケテンアセ
タールの製造を開示している。このシリルケテン
アセタールは対応するカルボン酸又はカルボン酸
のシリルエステンのリチウムジイソプロピルアミド、トリメチルクロロシラン及びテトラヒドロフ
ランとの接触による反応によって製造される。29~85%の所望シリルケテンアセタールの収率が記
載されている。Kuoらはこの収率が分析による
ものか物理的な単離及び分離によるものかについ
てふれていない。

第2の一般的方法では、シリルケテンアセター

特問的64-85982(4)

ルはカルポン酸のエステルとオルガノヒドロシラ ンのヒドロシリル化によって製造される。Petrov 60 J. Gen Chem. (USSR). 29 (1959), 2896~ 2899頁はメチルメタクリレートとトリエチルシラ ンの白金触媒反応を記載している。Ojima らのJ. Organometallic Chem. 111 (1976), 43~60頁は 触媒としてトリス (トリフェニルホスフィン) ロ ジウムクロリドの使用を研究している。Howeらの J.Organometallic Chem. 208 (1981), 401~406 頁及びYoshiiらのChem. Pharm. Bull 22 (1974), 2767~2769頁は触媒としてロジウムのオルガノ亜 りん酸化合物を用いる(Calla)。Sillとメチルメタ クリレートの反応による70~75%の収率のSKA の製造を記載している。Quirk らは欧州特許第 184692号(1986年 6 月18日発行)は o - シリル化 ケテンアセタールと、エノールエーテルと、ロジ ウム触媒存在下のアクリレートエステルとシラン 又はシロキサンの反応によるその製造方法とを閉 示している。

. . .

第3の方法では、Ishikawaらが米国特許第

4.482,729 号 (1984年11月13日発行) でフッ素化 カルボン酸エステルとトリメチルシリルトリフロ オロメタンスルホネートの反応によるフルオロア ルキルシリルケテンアセタールの製造を記載して いる。

第4の方法ではトリメチルクロロシランの存在における二置換マロネートのアルカリ金属立元によるシリルケテンアセタールの生成を伴なう。
KuoらのChemical Communications (1971)136
~137 買及びJ.Am.Chem.Soc.94:11 (1972) 4037
~4038頁は金属ナトリウムの存在におけるジアルキルジアルキルマロネートとトリメチルクロロシランの反応による式 R¹R²C=C(OR²)OS1(CH₂)。
(式中、R¹、R² はメチル基、エチル基フロンの反応による式 R¹R²C=C(OR²)OS1(CH₂)。
で中、R¹、R² はメチル基、エチル基であり、R² はメチル基であり、R² はメチルをひじている。とことを閉示している。さらに、Kuoらはキシレンを溶剤とする場合と異なること

を開示している。 K u o らが報告するこの結果は、この反応が溶剤が関与する反応であることを示している。 K u o らは式 R'R*C=C (OSi(CR₂)₃)₂ のシリルケテンアセタールをマロネートから製造できることを一切開示していない。

本発明の目的はマロネート化合物からシリルケ テンアセタール製造の有効な方法を提供すること である。

(課題を解決するための手段及び作用効果)

この明細書に聞示される、アルカリ金属の存在下の二置換マロネートとトリオルガノハロシランの反応は現在までに開示された従来技術の方法と比べてそれに優るいくつかの利点を有している。 先ず第1に、多数の二置換マロネートは商業的に 入手可能である。さらに、ピス(シリル)ジアル キルマロネートも入手容易な原料から容易に合成できる。

本発明を、カルボン酸のエステルと適当な金属 試薬との反応で金属マロネートを生成後、エノレ ートイオンとオルカリクロロシランを反応する方利とと、本発明はカルボニル化合物とジネストがとがれる。従来技術はカルボニルルのような強調を発っている。これらの医は、対策ないのでは、これらの医よりかなり高価など、を明で用いるでいた。追加試変の必要性は製造コストを増大させる。

特開昭 64-85982 (5)

ルアダクトCH、= CR'CH(OR*) (OSi(CH、)。) である。 カルボニルアダクトは上記アクリレート重合開始 剤としてのSKAの使用に対し損傷を加える。 従って、ヒドロシリル化によるSKAの調製はこれ らの不所望なカルボニルアダクトを除去するため に特別の処理工程を必要とする。

本発明ではいくつかの予想外の結果が気付かれた。式R'R*C=C(OR*) (OS1(CH₂)₂) 及び式

R'R'C=C(OSi(CHa)a)。のシリルケテンアセタールは両方とも二置換マロネートのアルカリ金属 還元により製造できることが見い出された。 さらに、化学登論的量を越える量のアルカリ金属がジアルキルマロネートの反応の完了を保証し、所望のシリルケテンアセタールの収率を最大限化することが見い出された。最後に、アルカリ金属の形態が反応系の反応性の重要な 因子であることが見い出された。これらの発見はどれも前記の従来技術によって示されたり示唆されたものではない。これらの発見の詳細については後で例によって説明する。

でのマロネート化合物からシリルケテンアセタールの調製方法が提供される。こうして、説明されるものは、

本発明によれば、本明細書で説明される条件下

(A) マロネート化合物をトリオルガノハロシロキサン及びアルカリ金属と接触させ、その際トリオルガノハロシロキサンはマロネート化合物に対

して化学登論的に過剰に存在し、マロネート化合

. O || 別は(i)式 R':c(COR')。を有するジアルキル

ジアルキルマロネート、(ii)式 R'*C(COSiR''*)。 を有するビス(トリアルキルシリル)ジアルキル

u マロネート、及び (iii) RizC(COH) を有するジアルキルマロン酸からなる群から選ばれ、トリオルガノハロシランは一般式 Riix (式中、 X はフッ条、塩素、臭素又はヨウ素である) を有する、そして

(8) 得られるシリルケテンアセタールを分離及

び単離する工程からなる。

一般式 R'zC=COSiR'! (式中、各R' 及びR'! 07

はそれぞれ独立して炭素原子 1 ~ 4 個のアルキル 基からなる群より選ばれ、 2 は炭素原子 1 ~ 4 個 のアルキル基とトリオルガノシリル基からなる群 より選ばれ、このトリオルガノシリル基は式

- SiR¹¹を有する)を有するシリルケテンアセタ - ルの細製方法である。

アルカリ金属の存在におけるジアルキルジアルキルマロネートとトリオルガノハロシランの反応は所望のシリルケテンアセタール、一酸化炭素、トリオルガノアルキルシラン及びハロゲン化アルカリ塩を生成する。ジアルキルマロン酸とトリオルガノハロシランの反応はピス(トリアルキルシリル)ジアルキルマロネートを生成し、ハロゲン化水素を発生する。

ジアルキルジアルキルマロネートは、例えば、 ジメチルジメチルマロネート、ジメチルジエチル マロネート、ジエチルジメチルマロネート、ジエ チルジェチルマロネート、メチルエチルジメチル マロネート、又はメチルエチルジェチルマロネー トであることができる。ジアルキルジアルキルマ ロネートから調製されるシリルケテンアセタール は、例えば、

(CH₃) (CH₃) C = COSi (CH₃)₃.

i

OCH₃

 $(C_2H_5)(C_2H_5)C = COSi(CH_3)$,

(CH₃) (CH₃) C = COSi (CH₃)₃,

 $(C_2H_5)(C_2H_5)C = COSi(CH_3)_3$,

(CH₃)(C₂H₃)C = COSi(CH₃)₃. 又は

OC.H.

OC-H.

(CH₃)(C₂H₅)C=COSi(CH₂); であることが

できる。

ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネ ートは、例えば、ピス (トリメチルシリル) ジメ

特開昭64-85982(6)

チルマロネート (CH₃)(CH₃)c (COSi(CH₃)₃)。又はピス (トリメチルシリル) ジエチルマロネート

(C₂H₃)(C₂H₃)C (COSi(CH₃)₃)₂ であることができる。ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートから調製されるシリルケテンアセタールは、例えば (CH₃)(CH₃)C = COSi(CH₃)₃又は

(C:H;)(C:H;)C = COSi(CH;);であることができる。 | | OSi(CH;);

ジアルキルマロン酸は例えばジメチルマロン酸、ジエチルマロン酸、又はジブチルマロン酸であることができる。

アルキル金属はリチウム、ナトリウム、カリウム、又はセリウムであることができる。 調製されるアルキル金属はナトリウム/カリウム合金のように 2 又は 3 以上の金属の合金の形で用いることができる。アルカリ金属はパラフィンのような適当な炭化水素溶剤中の分散体の形で用いることも

できる。アルカリ金属の形態は後の例に示されるようにピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートとトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属の反応に著しい影響がある。

ジアルキルジアルキルマロネート又はピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートのいずれかからシリルケテンアセタールを調製する場合、マロネート化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程は、

- (C) トリオルガノハロシランをアルカリ金属と混合し、
- (D) トリオルガノハロシランとアルカリ金属の 混合物にジアルキルジアルキルマロネートを添加 し、そして
- (E) ジアルキルジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ金属の間の反応を促進してシリルケテンアセタールを生成する、 工程からなる。トリオルガノハロシランとアルカリ金属の混合は標準パッチ化学反応系で行なうことができる。反応器には適当な撹拌具を装備して

ジアルキルマロン酸で出発するシリルケテンア セタールの調製では、マロネート化合物をトリオ ルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる 工程(A) が、

- (K) トリオルガノハロシランの第1の部分をトリアルキルマロン酸と混合し、
 - (L) 工程(K) で得られる混合物の反応を促進し

【 て式 R'*C(COSiR''*)* を有するピス (トリアル キルシリル)ジアルキルマロネートを生成し、

- (M) 工程(L) で生成したピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを分離及び単離し、
- (N)トリオルガノハロシランの第2の部分をアルカリ金属と混合し、
- (P) トリオルガノハロシランの第2の部分とアルキル金属と混合物にピス (トリアルキルシリル)ジアルキルマロネートを添加し、そして
- (Q) ピス (トリメチルシリル) ジアルキルマロ ネート、トリオルガノハロシラン、及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセター ルを生成する

工程からなる。選択的に、ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを単離及び分離せずに、マロネート化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程が(A) が、

- · (F) トリオルガノハロシランをジアルキルマロン酸と混合し、
- (G) 工程(P) で得られるトリオルガノハロシランとジアルキルマロン酸の反応を促進してピス

特開昭64-85982 (7)

(トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを 生成し、

- (H) 工程(G) で得られる混合物にアルカリ金属 を添加し、そして
- (J) ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセター ルを生成する

工程からなる。混合及び「反応促進」のための装備は実質的に前に説明した。トリオルガノハロシランとジアルキルマロン酸の間の反応を促進するために必要な追加の装備は水素化ハロケンのの装備である。この装備はこれらの気体が生成したときに気体を反応器より排気な装備一を合むことができる。これらの変には、これらの変に、これらの変に、、これらの変には、できないので、できないのでは、これらの変には、できないので、できないが、できないが、できないが、できないが、できないが、できないが、できないが、でいく、ないでは、ないでは、いいで、ないのでは、ないのでは、いいのでは

ができる。

出発マロネート化合物がジアルキルジアルキル マロネート又はピス(トリアルキルシリル)ジア ルキルマロネートのいずれかであるシリルケテン アセタールの調製では、マロネート化合物に対す るトリオルガノハロシランの化学量論的量は2.0: 1である。本発明の目的において「マロネート化 合物に関して化学量論的に過剰」とは化学量論的 量より大きいモル比を意味する。マロネート化合 物、アルカリ金属及びトリオルガノハロシランの 間の反応の完了を確実にし、また反応体スラリー の充分な希釈を確実にするために、マロネート化 合物に関するトリオルガノハロシランのモル比は 約3.0:1より大(約50%以上の化学量論的過 刺)でなければならない。このモル比は約5.0: 1より大きい(約 150%以上の化学量論的過剰量) であることが好ましい。さらに好ましくは、この 化学量論的過剰が約50~150 %の範囲内である。

出発マロネート化合物がジアルキルマロン酸で あるシリルケテンアセタールの調製では、トリオ

ルガノハロシランの化学量論的量としては、ピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを 生成するために1.0モルのジアルキルマロン酸と の反応に2.0モルのトリオルガノハロシランが必 要である。さらに、1.0モルのピス(トリアルキ ルシリル) ジアルキルマロネートとの次の反応の ために2.0モルのトリオルガノハロシランが必要 である。ジアルキルマロネート、アルカリ金属及 びジアルキルマロネートの間の反応の完了を確実 にするためにはジアルキルマロン酸に関するトリ オルガノハロシランのモル比は約5.0:1より大 (約 150%以上の化学量論的過剰) でなければな らない。このモル比が約7.0:1より大(約250 %以上の化学登論的過剰)であることが好ましい。 最も好ましくはこの化学量論的過剰が約 150~ 250 %の範囲内である。

マロネート化合物に関するトリオルガノハロシランの化学量論的過剰は迅速かつ完全な反応を確実にするために必要である。又、過剰量のトリオルガノハロシランは、液体-固体反応スラリーが、

後の処理のために反応混合物の撹拌及び移動を促進するために充分に流動性であることを確実にする溶剤としても働く。上記より多量のトリオルガノハロシランを用いてもよいが、そのように過剰に用いてもそれ以上の効果はないものと考えられる。

特開昭64-85982 (8)

り大きい化学量論的過剰量のアルカリ金属を用いてもよいが、付加的な利点はない。逆に、化学量 論的量より少ない量を用いてもよいが、反応の完 了が乱れるであろう。

上記のようにトリオルガノハロシランとアルカリの強関の両方が過剰で、これらとジアルキルジアルキルマロネートと反応によりSKAを調製する場合、反応混合物は自発的に発熱してトリオルガノハロシランの還流とは誘腿温度まで達し、して、混合物は数時間後に冷却する。このようにして、切合物は数時間後に冷却する。この時間以内に完了する。反応は関本わずかに2時間ほどで実質に完する。より高温では必要な反応時間をさらに短縮する。

トリオルガノハロシランとアルカリ金属の両方が過剰で、これらとピス (トリアルキルシリル)ジアルキルマロネートの反応では、反応を合理的な時間で行なうためには高温が必要のように思われる。本発明者はアルカリ金属が (以下の例に記すように) パラフィン中の分散体のように反応性

の形態である場合約50 と以上の温度で20時間後に反応が実質的に完了することを見い出した。 反応は屢々約50 との温度で2~10時間という 短時間で実質的に完了した。

シリルケテンアセタールの分離及び単離は

- (0) ハロゲン化アルカリ固体の除去、及び
- (R) 蒸留によるシリルケテンアセクールの回収よりなる。 固体ハロゲン化アルカリ金属は所望のSKAを生成する反応の生成物である。 この塩はSKAのモル当り 2 モルの量で発生する。 これらの塩は粗反応混合物から塩の滤過のような公知の手法で除去することができる。 加圧滤過のような工業的滤過方法を用いることも可能である。

固体不含粗反応混合物からの所望のSKAの回収は蒸留のような公知の手法で行なうことができる。下記の例において本発明の方法で調製する SKAは少なくとも95重量%の純度に蒸留して回収することができる。

(実施例)

当業者が本発明をよりよく理解するために、以下に例を記載する。これらの例は説明のためであり、本発明の範囲を限定するものではない。 例1

金属ナトリウムの存在においてジアルキルジアルキルマロネートとトリメチルクロロシランの反応によりシリルケテンアセタール(SKA)を調製した。この調製の手順はジアルキルジアルキルマロネートからSKAを調製する以下の例の典型である。

機械式スターラと選流凝縮器を装備した 500 ㎡ の三首実験用フラスコに2512 g (23.1モル)のトリメチルクロロンランを添加した。この反応用フラスコに2512 g (23.1モル)のトリメチルクロロシランを添加した。この反応用フラスコに2 g片にカットした金属ナトリウム266 g (11.6モル)を添加した。フラスコ中の混合物を撹拌し、系を窒素パージ下に置いた。反応用フラスコに取付けた追加用獅斗に1000 g (4.62モル)のジェチルジ

エルマロネートを添加した。トリメチルクロロシラン、金属ナトリウム、及びジエチルジェチルマロネートは商業的に入手可能である。

ジェチルジェチルマロネートをフラスコに約30 ml/分の速度で添加した。全添加時間は約30分であった。反応は著しい発熱を伴なって自発的に始まった。マロネート物質の添加後約15分で急速な一酸化炭素の発生が始まった。マロネート添加後約3時間で自発的な反応混合物の還流が完了した。系を窒素パージ下撹拌して一夜置いた。

フラスコ中の試料を取り出し、ガスクロマトグラフ法で分析した。分析は反応が実質的に完了したことを示した。存在するマロネート型物質(過剰のトリメチルクロロンラン、トリメチルエトキンシラン及びその他の非マロネート物質を除く)に基づくと、粗反応液は分析値として94.0%(ガスクロマトグラフ面積%)の所望SKA:

(CzH₃)(CzH₃)C = COSi(CH₃)₃, 2.2 %のジェチル | | OC₂H₃

特開昭64-85982 (9)

ジエチルマロネート及び1.7%のエチル2-エチ

)

ルプチレート (CzHs)(CzHs)CHCHCzHs を示した。

次に、混合物を認過器(Iritted filter medium)で関準減圧滤過して塩化ナトリウムと未反応金属ナトリウムを除去した。滤過した固体をトリメチルクロロシランで洗浄した。得られる滤液及び洗浄液を混合し、減圧下で揮発物を除去した。揮発物除去した物質を次に実験室蓋留装置で減圧蒸留した。蒸留中オーバヘッド生成物の温度を 8 mallgの圧力で67~68でに保持した。全部で 936gの生成物がオーバヘッドに得られた。 734gを取り出し、ガスクロマトグラフィ分析すると98%以上の所盟シリルケテンアセタールが見い出された。

上記の結果は、金属ナトリウムの存在における ジアルキルジアルキルマロネートとトリアルキル ハロシランの反応で、過剰のトリアルキルハロシ ランを反応混合物の溶剤又は希釈剤として用い、 金属ナトリウムが化学量論より過剰に存在すると、 シリルケテンアセタールを高い収率で生成し得る

合物をサンプリングしてガスクロマトグラフ法で分析した。例1のように、結果は過剰のトリメチルクロロシランと副生成物トリメチルエトキシシランを除外する。

表1にこのシリーズの5つの実験の結果をまとめて示す。5つの実験は試料A~Eとして示す。実験の内容としては、(1) ジエチルジエチルマロネートに対するナトリウムのモル比(2.0が化学量論的モル比である)—「Na 比」として示した一、(2) ジエチルジエチルマロネートに対す量論的モル比である)—「Mes比」として示す—、(3) 反応用フラスコの出発温度(で)—「温度」として示す—、(4) SKA及び未反応ジエチルジエチルマロネートの含分についての反応液のガスクロマトグラフ分析値—「SKA(%)」及び「マロネート(%)」として示す—で特定する。

ことを示している。

642

金属ナトリウムの存在においてジェチルジェチ ルマロネートとトリメチルクロロシランの反応に よりシリルケテンアセタール

(CzHs)(CzHs)C - COSi(CHz)った製造する実験を何 | | OCzHs

回か行なった。製造手順と分析手法は例1と同様である。

例1におけるように、小片状(下部分0.1~0.5 g片)の金属ナトリウムを約2 5 でのトリメチルクロロシランに添加した。2 5 での温度は出発温度である。マロネート物質を添加すると、反応混合物は自発的に発熱し、それから反応が進行すると冷却した。1つの場合、マロネート化合物を添加する前に反応用フラスコを加熱して約5 8 で退流した。

ジェチルジェチルマロネートは約1~5分間で 添加した。すべての実験においてフラスコは所望 の温度に20時間保持した。20時間後に液体混

表 1

战科	Na H	Me, H	温度	マロネート(%)	S K A (%)
Α	2. 0	5. 0	2 5	8. 0	88.0
В	2. 0	5. 0	5 8	8. 0	88.0
С	2. 5	5. 0	2 5	1. 6	92.9
D	2. 5	3. 0	2 5	1. 2	92.4
E	2. 5	5. 0	2 5	2. 2	94.0

上記の結果は過剰のトリメチルクロロシランの存在においてその他の溶剤の存在はなしでシリルケテンアセタールは効果的に調製されることを示している。さらに、これらの結果は化学型論的量を越える量のナトリウムがジアルキルジアルキルマロネートの所望SKAへの高い変換率を促進することを示している。

174 3

金属ナトリウムの存在においていろいろなジア ルキルジアルキルマロネートとトリメチルクロロ シランの反応でシリルケテンアセクールを調製す る実験を行なった。SKAは式

R₂C=C(OR') (OSi(CH₃)₃) で扱わすことができ

特開昭64-85982 (10)

る。対応するジアルキルジアルキルマロネートは 式 R₂C(CO₂R′)₂で表わすことができる。R及び R ′ はメチル基 (Me) 又はエチル基 (Et) の いずれかを衷わす。これらのSKA及び出発ジア ルキルジアルキルマロネートを衷2に示す。これ らのSKAを製造する実験はそれぞれ試料F~K として示す。衷2においてジアルキルジアルキル マロネートは「DADAM 」として示す。

衷 2

<u> </u>	S K A	DADAN
F	Et 2C = C(OEt) (OSi(Cll 3) 3)	EtzC(COzEt)z
G	$Me_2C = C(OEt) (OSi(CH_2)_3)$	Me _z C(CO ₂ Et) ₂
H	$Et_2C = C(OMe) (OSi(CH_3)_3)$	EtzC(COzNe);
J	$Me_2C = C(ONe) (OSi(CH_3)_3)$	Me _z C(CO _z Me) _z
ĸ	$Me_zC = C(OMe) (OSi(CH_2)_3)$	MerC(COrHe)r
ジエラ	チルジエチルマロネート、ジエ	チルジメチル
70;	ネート及びジメチルジエチルマ	ロネートは商
菜的に	こ入手可能な中間体である。ジ	ジメチルジメチ
ルマリ	ロネートは現在簡葉的に入手可]能な中間体で
はなり	n.	

ウムの存在においてトリメチルクロロシランと反 例4 応させた。 表 3 にこれらの結果をまとめる。 表 3 中の表記は例2におけると同じである。

<u>表 3</u>

試料	Na H	Мes H	温度	マロネート <u>(%)</u>	S K A (%)
F	2.5	3. 0	2 5	1. 2	92.4
G	2. 5	5. 0	2 5	2. 6	91.2
н	2. 25	5. 0	2 5	1. 2	90.2
J	2. 25	5. 0	2 5	2. 0	95.2
ĸ	2. 25	5. 0	2 5	3. 2	93.5

上記の結果は対応するジアルキルジアルキルマ ロネートからの1連のシリルケテンアセタールの 調製を示す。上記の結果は、さらに、化学量論的 量を越える量の金属ナトリウムの使用の利点を示 す。最後に、上記の結果は過剰のトリメチルクロ ロシランを用いて追加の溶剤の必要性を除いた方 法でシリルケテンアセタールを有効に製造できる ことを示す。

ジメチルジメチルマロネートは商業的に入手可 能なジメチルマロネートから調製した。ジメチル マロネートは、ジメチルマロネートをナトリウム メトキシドのメタノール溶液に添加する公知の方 法でアルキル化した。この混合物を通して過剰の 塩化メチルをパブルした。アルキル化は、ジメチ ルマロネートの最初ジメチルメチルマロネートに 変換後、さらにナトリウムメトキシド及び塩化メ チルと反応してジメチルジメチルマロネートを生 成する2段階で起きる。約95%がジメチルジメ チルマロネートであるマロネート物質の粗混合物 が生成した。塩化ナトリウムを担生成物から水で 洗浄した。ジメチルジメチルマロネート生成物は 波圧蒸留で分離した。ジメチルジメチルマロネー トは8 mm Hg の圧力で60~61でのオーバベッド温度 で蒸留した。こうして回収したジメチルジメチル マロネートはガスクロマトグラフィ分析で99.8% の純度を有した。

上記ジアルキルジアルキルマロネートを例2で 用いたと同じ手順及び分析法を用いて金属ナトリ

金属ナトリウムの存在におけるピス(トリアル キルシリル) ジアルキルマロネート

(CH₃)₂C (CO₂Si(CH₂)₃)₁ とトリメチルクロロシ ランの反応によりシリルケテンアセタール (CHs) *C=C(OSi(CHs)*)*を調製した。

ピス (トリメチルシリル) ジメチルマロネート (BTMSDMM)を市販のジメチルマロン酸 (DMA) より調製した。 1 モルのDMAを2モルより僅か に多いトリメチルクロロシランと反応した。 反応 混合物を加熱して所望のBTMSDMM を穏やかに発生 させた。BTMSDMM を真空蒸留法で単離及び回収し た。BTHSDMH は1 4 mm Hgで 101~103 てのオーバ ヘッド温度でオーバヘッド生成物として回収した。 BTMSDMM はガスクロマトグラフィーで測定して 99%を超える純度を有した。

例2及び例3で用いたと同様の手法でBTMSDMM を金属ナトリウムの存在においてトリメチルクロ ロシランと反応した。ガスクロマトグラフィーを 用いて粗生成物を分析した。 5.0 モルのトリメチ

特開昭64-85982(11)

ルクロロシラン及び 2.25モルの金属ナトリウムを BTMSDMM の1モル当りに用いた。反応は室温で約 6日間進行させた。粗生成物をガスクロマトグラ フィーで分析すると85.0%の所望SKAと3.1% の未反応BTMSDHM を含んでいた。

上記の結果は金属ナトリウムの存在におけるビ ス(トリアルキルシリル)ジアルキルマロネート とトリオルガノハロシランの反応によるピスーシ リルケテンアセタールの調製を示している。 例 5

シリルケテンアセタール (CH₂),C=C (OSi(CH₂),), 上記の結果は過剰のトリオルガノハロシラン中 を、BTMSDMM を単離しない1工程方法で調製した。 この特別の調製では7.0モルのトリメチルクロロ シランと1.0モルのジメチルマロン酸をフラスコ に装入した。混合物を加熱して環流してすべての 固体ジメチルマロン酸を消失させた。次に混合物 を約25℃に冷却した。次に、フラスコに細片状 の金属ナトリウム 2.25モルを添加し、混合物全部 を加熱して環流した。反応は撹拌して8日間続け た。この時点で、粗生成物をサンプリングし、ガ

スクロマトグラフ法で分析した。粗生成物の分析 値は92.3%のSKAと5.1%のBIMSDMM であった。 割生成物の固体塩化ナトリウムは標準減圧滤過法 で分離した。濾過した固体は新鮮なトリメチルク ロロシランで洗浄した。所望SKAは真空蒸留で 単型し、回収した。所望生成物は 105 m Hgで115 ~117 てのオーバヘッド温度で取出した。オーバ ヘッド生成物の約62重量%からなる部分を単型 し、ガスクロマトグラフ法で分析すると所望SK Aは98%以上であった。

のジアルキルマロン酸から出発してピス(トリア ルキルシリル)ジアルキルマロネートの単離及び 分離を行なわない方法でシリルケテンアセタール を製造できることを示している。

(CH₃)₂C = C (OSi(CH₃)₃)₂を調製する2つの実 験を行なった。これらの実験はBTMSDMM 及びトリ メチルクロロシランの反応に対する金属ナトリウ ムの形態の影響を調べるために行なった。これら

の実験は例4の手順及び分析法を用いて行なった。

最初の実験(試料M)では金属ナトリウムを液 体パラフィン中の50重登%分散体として添加し た。第2の実験(試料N)ではナトリウムをナト リゥム/カリゥムの重量比70:30の合金として導 入した。パラフィン中ナトリウム分散体は市販さ れている。ナトリウム/カリウム合金は金属カリ ウムの細片をアルゴン雰囲気中で溶融ナトリウム と混合する方法で 2 種の金属を物理的に混合して 調製した。パラフィン中ナトリウム分散体の場合、 分散体をトリメチルクロロシランに添加し、この 混合物にBTMSMMを添加した(例4の手順の如く)。 ナトリウム/カリウム合金の場合、トリメチルク ロロシランを合金に非常にゆっくりと添加した。 それからBTMSMMをこの混合物に添加した。両方の 実験において、金属ナトリウムの登は BTMSDMM の1モル当り 2.25モルである。

どちらの調製においても、金属ナトリウムはト リメチルクロロシランに添加したとき非常に活発 に反応した。反応混合物は撹拌しながら約20時 ス(トリアルキルシリル)ジアルキルマロネート

間覆いた後サンプリングと分析を行なった。しか しながら、ナトリウム/カリウム合金の場合、本 発明者は反応混合物の挙動からみて、反応はかな り短かい時間―約2時間と思われる―で完了した と強く確信している。

表 4 はこれら 2 の実験の結果をまとめたもので ある。比較として金属ナトリウムを細片として添 加した例4の実験を含め、試料Lとして標記した。 表 4 は(1) 反応期間 (「期間」と表記)、(2) 粗 生成物のSKA含分 (「SKA (%)」と衷記)、 及び(3) 粗生成物の未反応マロネート合分 (「マ ロネート(%)」と裏記)による結果を示してい

区扫		<u>SKA (%</u>)	<u>マロネート (%</u>)
L	6 日	85.0	3. 1
М	2 0 時間	76.1	6. 9
N	2 0 時間	90.6	2. 0

上記の結果は用いる金属ナトリウムの形態がビ

特開昭64-85982 (12)

手 続 補 正 書(方式)

昭和63年10月6日

特許庁長官 吉 田 文 毅 股

1. 事件の表示 昭和63年特許顯第167029号

2. 発明の名称 シリルケテンアセタールの製法

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

名称 ダウ コーニング コーポレーション

- 4. 代 理 人 住所 〒105 東京都港区虎ノ門ー丁目8番10号 前光虎ノ門ビル 電話 504-0721 氏名 弁理士 (6579) 費 木 朗 (外4名)
- 5. 補正命令の日付 昭和63年9月27日 (発送日)

することを示している。

とトリオルガノハロシランの反応速度に影響を有

特許出願人 ダウ コーニング コーポレーション

特許出願代理人 弁理士 青 木 弁理士 石 田 弁理士 古 賀 哲 次 弁理士 山 口 昭 之

弁理士 西 山 雅 也

6. 補正の対象

明細書

7. 補正の内容

明細書の浄む(内容に変更なし)

8. 添附書類の目録

净售明細督

1通

号_(特開昭

庁内整理番号

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

62-87594 号, 昭和 62 年 4 月 22 日 発行 公開特許公報 62-876 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ

識別記号

243274

Z-8018-4H

平成 2.6.-5 発行 手 椋 柿 正 苷

平成2年2月 9 日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殷

1. 事件の表示

昭和61年特許顯第243274号

高純度シリルケテンアセタールの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 ダウ コーニング コーポレーション

4. 代 理 人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 前光虎ノ門ビル 電話 504-0721 (之資料

(外 5 名)

5. 補正の対象

昭和 61 年特許願第

Int. C1.

CO7F 7/18

たので下記のとおり掲載する。

明細書の「特許請求の範囲」の欄

8. 補正の内容

別抵の通り

7. 添付書類の目録

特許請求の範囲

2. 特許請求の範囲

1. 主として.

(1) $R_{a}Si(0c = C(CH_{a})_{2})_{4-8}$

(cH2)v (11) ÇH, $((CH_3)_2C = C - O(i -)_3O(Si - O)_w$ ĊH, CH. (¢112) v

(II)

1 通

(\$',\$i),0(R'',\$i0)x(R'''\$i0 → , $dc = c(cH_{\bullet})$

0(CH2) vZ

ÇII, ((CH)),C=CO\$iO),Si O CH. (cn.) vz

〔式中Rは炭素原子数1~4のアルキル基、アリ

(95) -/-

ール基及び炭素原子数1~4のアルコキシ基から成る群から選択され、aは0,1,2又は3の数値を有し、vはそれぞれの場合に0,1,2又は3の数値を有し、vは0~25の数値を有し、xは1~100の数値を有し、pは1~35の数値を有し、R¹,R¹及びR¹はそれぞれ独立に炭素原子数1~4のアルキル基及びアリール基から成る群から選択され、2はそれぞれの場合に独立に、

- (i) H
- (ii) OII.
- (iii) SiR I*R VR VI(式中R I*, R V及びR VIは それぞれ独立に炭素原子数 1~4のアルキル基、 アリール基及び炭素原子数 1~4のアルコキシ基 から成る群から選択される)、
 - (iv) OSIR'YRYRYI,
 - (v) CH(CH₂)₂,

亚 2.6.-5 新

(式中Xは水素又は(CH2)。- s(CH3)である)、

(vii) - (CII.) b O CH (CII.) O (CII.) c (CII.) (式中 b 及び c はそれぞれ 1 ~ 4 の数値を有する)

(vii) 0 - Si (OCC = CH;) 3-(d+e+r) (R*'''dR*''''eR''*,) CH;

(式中R^{VII}, R^{VIII}及びR^{IX}はそれぞれ独立にR^{IV}, R^V 及びR^{VI}から選択され、これらと同じ定義を有し、d, e及びrはそれぞれ O 又は 1 の数値を有する).

- (ix) NR*R*'(式中R* 及びR*'はそれぞれ独立にR'*, R*及びR*'から選択され、これらと同じ定義を有する)、
- (x) Y (式中Yは独立に炭素原子数1~20のアルキル基、アルケニル基若しくはアルカジエニル基: 炭素原子数6~20のシクロアルキル基、アリール基、アルカリール基若しくはアラルキル基: その脂肪族部分に1個以上のエーテル酸条原子を含む前記の基;及び重合条件下に非反応性の官能性置換基を1個以上含む前記のような基から

成る群から選択される)、

(xi) -N=C=0

から成る群から選択される〕から成る群から選択された一般式のシリルケテンアセタール物質を製造するため、(A)主として(i)メタクリル酸及び(ii)一般式

 $CH_2 = CH(CH_2)COO(CH_2)_VZ$

(式中 v 及び z は前記のものを表す)のメタクリル酸エステルから成る群から選択されたビニル化合物を無機ロジウム化合物の存在で一般式(V)~(M):

- (V) RaSill.a.
- (Yi) CH , CH , (HSi),0(SiO) w CH , CH ,
- (別) (R',Si),O(R'',SiO)*(R'''HSiO)*
 及び
 - (MI) CH,

〔式中 R¹, R¹, R¹¹¹, a, w, x及び y は前記のものを表す〕を有する水素含有有機珪素物質と接触させ、(B) 粗製生成物から所望の生成物を分離し、単離することから成る高純度シリルケテンアセタール物質の製造方法。

- 2. ロジウム化合物がRhCl。・3H。O である特許 請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. ビニル化合物に対するロジウムの濃度がモル基準で少なくとも50ppm である特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 4. 反応温度が30~80℃の範囲内である特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 5. 水素含有珪素物質とビニル化合物の反応を 大気圧以上で行なう特許請求の範囲第1項記載の 方法。
- 6. 水素含有硅素物質とピニル化合物が少なくとも1時間の期間にわたって反応する特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 7. ピニル化合物に対してモル基準で少なくと も12%過剰の水業含有珪素物質が存在する特許請

求の範囲第1項記載の方法。

- 8. 所望のシリルケテンアセタールを分離し、 単離するために蒸溜を行なう特許請求の範囲第1 項記載の方法。
- 9. ビニル化合物がメタクリル酸メチルであり、水素含有珪素物質が(CII」)」Sill であり、ロジウム化合物がRhCI。・3ll1のであり、そのロジウム浪度がメタクリル酸メチルに対するモル基準で50~(400ppmであり、メタクリル酸メチルに対する(CH」)」Sill のモル過剰が12%より多く、反応圧力を40℃~75℃の範囲とし、反応圧力を少なくとも大気圧とし、メタクリル酸メチルと(CII」)」Sill との反応時間を少なくとも2時間とし、反応圧力を少なくとも大気圧とし、シリルケテンアセタール(CII」)」C= C(0CH」)(OSiCH」)を分離し、蒸溜により単離する特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 10. メタクリル酸メチルに対するRhCI, 3H₂O の濃度がモル基準で 200~300ppnであり、メタク リル酸メチルに対する(Cll₃),Sill のモル過剰が12 ~25%であり、反応温度を45~55でとし、メタク

平成 2.6.-5 発行

リル酸メチルと(Cll.s)。Sill との反応時間を2~8時間とし、反応圧力を本質的に大気圧とし、最終生成物のシリルケテンアセタールが95重量パーセントより多い特許請求の範囲第9項記載の方法。

- 11. シリルケテンアセタールが 1 重量パーセント未満のカルボニル付加物
- CH,=C(CH,)CH(OCH,)(OSi(CH,)) を含有する特許請求の範囲第10項記載の方法。
- 12. 反応圧力が 200psig以下である特許請求の 範囲第10項記載の方法。
- 13. ビニル化合物が4-メチル-3,5-ジオキシへプチルメタクリレート

CII₂ = C(CII₂) COOCII₂CII₂OCIICII₃OCII₃CII₃ であり、水素含有珪素物質が(CII₃)₃SiII であり、 触媒がRhCI₃・3H₂O であり、4ーメチルー3、5 ージオキシへプチルメタクリレートに対する触媒 の濃度がモル基準で200~2000ppmであり、4ーメ チルー3、5ージオキシへプチルメタクリレート に対する(CII₃)₃SiII のモル過剰が12%より大きく、 反応温度を25~55℃とし、反応圧力を少なくとも

大気圧とし、最終シリルケテンアセタール物質 (CH₂),C=C(OSi(CH₃),)(OCH₂CH₃OCH(CH₃))の間に (CH₃)を分離し、蒸溜して単離する特許請求の範囲第 1 項記載の方法

- 14. 最終生成物のシリルケテンアセタール合分が95重量パーセントより大きい特許請求の範囲第13項記載の方法。
- 15. シリルケテンアセタールが 1 重量パーセント未満のカルポニル付加物
- CH,=C(CH,)CH(OSi(CH,),)(OCH,CH,OCH(CH,)OCH,CH,) を含有する特許請求の範囲第13項記載の方法。
- 16. ビニル化合物が
- CH = C(CH,)COOCH,CH,OS;(CH,),

であり、水素含有珪素物質が(CH₃),SiB であり、 触媒がRhCl₃・3日₂0 であり、ビニル化合物に対す る触媒の濃度がモル基準で300~3000ppnであり、 ピニル化合物に対する(CH₃),SiB のモル濃度が12 %より大きく、反応温度が25~55℃であり、反応 圧力が少なくとも25~55℃であり、最終シリルケ テンアセタール物質 (Cll₃)₂C₅C(OSi(Cll₃)₃)(OCll₂Cll₃OSi(Cll₃)₃) を分離し、単離する特許請求の範囲第1項記載の 方法。

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 63 年特許願第 167029 号 (特開平 1- 85982 号, 平成 1 年 3 月 30 日発行 公開特許公報 1- 860 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 3 (2)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
CO7F 7/18		C-8018-4H
·		
!	- 1	•

平成 4, 3, 4 免行 手 統 補 正 ·

平成3年11月6日

特許庁長官 深 沢 亘 段

1. 事件の表示

昭和63年特許願第167029号

2. 発明の名称

シリルケテンアセタールの製法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 ダウ コーニング コーポレーション

4. 代理人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目 8 番10号 静光虎ノ門ビル 電話 3504-0721

有特种

- 5. 補正の対象
- (1) 明細書の「特許請求の範囲」の側
- (2) 明細書の「発明の詳細な説明」の閲
- 6. 補正の内容
 - (1) 特許請求の範囲を別紙の通りに補正する。
- (2) 明細啓第17頁において、第1行目の「。」
- を『、』に補正し、第2~3行目の「B'zC=COSiB''」 | | 02

を『Ric=cosiri'に補正し、第8行目の「-sir'」

o z

を『-SiRi'。』に補正する。

7. 添付書類の目録 特許請求の範囲

1通

2. 特許請求の範囲

1.(A) マロネート化合物をトリオルガノハロシロキサン及びアルカリ金属と接触させ、その際トリオルガノハロシロキサンはマロネート化合物に対して化学量論的に過剰に存在し、マロネート化

|| 合物は(i)式 Rⁱ₂C(CORⁱ)。を有するジアルキ

ルジアルキルマロネート、(ii)式R'.c(cosiR':,). を有するピス(トリアルキルシリル)ジアルキル

マロネート、及び(m)式 Ric(COH)。を有するジアルキルマロン酸からなる群から選ばれ、トリオルガノハロシランは一般式 RiisSiX (式中、X はフッ素、塩素、臭素又はヨウ素である)を有する、そして

(B) 得られるシリルケテンアセタールを分離及

び単離する工程からなる、

一般式 R'zC=COSiR'',(式中、各R' 及びR''

はそれぞれ独立して炭素原子1~4個のアルキル基からなる群より遺ばれ、2は炭素原子1~4個のアルキル基とトリオルガノシリル基からなる群より選ばれ、このトリオルガノシリル基は式
- SiRⁱⁱを有する)を有するシリルケテンアセタールの調製方法。

2. 錆求項1において、マロネート化合物がジアルキルジアルキルマロネートであり、シリルケテンアセタールが一般式 RizC=COSiRii,を有し、OR'

マロネート化合物をトリオルガノハロシラン及び アルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (C) トリオルガノハロシランをアルカリ金属と混合し、
- (D) トリオルガノハロシランとアルカリ金属の 混合物にジアルキルジアルキルマロネートを添加 し、そして

工程からなる方法。

4. 請求項1において、マロネート化合物がジアルキルマロン酸であり、シリルケテンアセタールが一般式 RigC=COSiRii。を有し、マロネート

化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (F) トリオルガノハロシランをジアルキルマロン設と混合し、
- (G) 工程(F) で得られるトリオルガノハロシランとジアルキルマロン酸の反応を促進してビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを 生成し、
- (B) 工程(G) で得られる混合物にアルカリ金属 を添加し、そして
- . (J) ビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセクールを生成する

工程からなる方法。

- (E) ジアルキルジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ金属の間の反応を促進してシリルケテンアセタールを生成する、工程からなる方法。
- 3. 請求項 1 において、マロネート化合物がビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートであり、シリルケテンアセタールが一般式 B':C=COSiR''。を有し、マロネート化合物をトーのSiR''。

リオルガノハロシラン及びアルカリ金属と接触させる工程(A) が、

- (C) トリオルガノハロシランをアルカリ金属と 混合し、
- (D) トリオルガノハロシラン及びアルカリ金属 の混合物にピス(トリアルキルシリル)ジアルキ ルマロネートを添加し、そして
- (E) ビス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネート、トリオルガノハロシラン及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケランアセタールを生成する

5. 請求項1において、マロネート化合物がジアルキルマロン酸であり、シリルケテンアセタールが一般式 RisC=COSiRii。を有し、マロネートしSiRii。

化合物をトリオルガノハロシラン及びアルカリ金 属と接触させる工程(A) が、

- (K) トリオルガノハロシランの第1の部分をトリアルキルマロン酸と混合し、
 - (L) 工程(K) で得られる混合物の反応を促進し

て式 Ri_C(COSiRii」)』を有するピス(トリアル キルシリル)ジアルキルマロネートを生成し、

- (M) 工程(L) で生成したビス(トリアルキルシ リル) ジアルキルマロネートを分離及び単難し、
- (N) トリオルガノハロシランの第2の部分をアルカリ金属と混合し、
- (P) トリオルガノハロシランの第2の部分をアルキル金属の混合物にピス (トリアルキルシリル) ジアルキルマロネートを添加し、そして
 - (Q) ピス (トリメチルシリル) ジアルキルマロ

ネート、トリオルガノハロシラン、及びアルカリ 金属の間の反応を促進してシリルケテンアセター ルを牛成する

工程からなる方法。

6. 請求項2において、アルカリ金属がナトリウムであり、トリオルガノハロシランがトリメチルクロロシランであり、ジアルキルジアルキルン ロネートを基準にして化学量論的にナトリウムが約5%以上、トリメチルクロロシランが約50%以上過剰に存在し、出発接触温度が約25で以上であり、接触時間が少なくとも2時間であり、塩化ナトリウムを渡過で除去し、シリルケテンアセタールを落留で分離及び単離する方法。

7. 請求項 3 において、アルカリ金属がナトリウムであり、トリオルガノハロシランがトリメチルクロロシランであり、ピス(トリアルキルシリル)ジアルキルマロネートを基準にして化学量論的にナトリウムが約 5 %以上、トリメチルクロロシランが約 5 0 %以上過剰に存在し、出発接触温度が約 5 0 で以上であり、接触時間が少なくとも

平成 4, 3, 4 発行

2時間であり、塩化ナトリウムを滤過で除去し、 シリルケテンアセタールを蒸留で分離及び単難す る方法。

8. 請求項 4 において、トリオルガノハロシランがトリメチルクロロシランが約 150%以及 地にしてトリメチルクロシランが約 150%以及 化学量論的に過剰に存在し、シアルキルシロンと 3 0 で以上であり、ビス (トリアルキルションと 2 時間であり、ビス 基準に ひでは 2 時間であり、塩化ナトリカムを 間間が少で 2 がり 2 がり 5 %以上であり、 塩化ナトリカムの間が少で 2 がり 2 がり 5 %以上であり、 塩化ナトリカムを 2 時間であり、塩化ナトリウムを 2 時間であり、塩化ナトリウスを 2 がり 2 がり 3 方法・